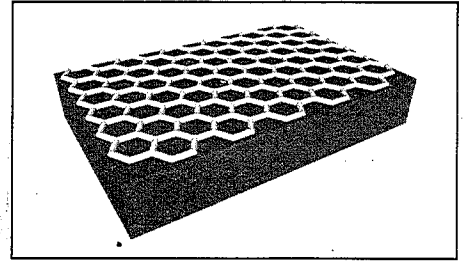




使用原子層沉積技術在氧化層上直接成長無需轉移技術之石墨烯

發明人：陳敏璋 教授
單位：國立臺灣大學 材料系
簡歷：

http://www.mse.ntu.edu.tw/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=47&Itemid=902&lang=tw



市場及需求：奈米科技需要的石墨烯製程技術

技術摘要(含成果)：無須轉印之石墨烯製程技術

優勢：改善傳統石墨烯需要轉印至其他基材才能進一步應用所造成的限制

競爭產品：利用化學氣相沉積(Cheical Vapor Deposition, CVD)製備石墨烯之製程技術

專利現況：
無

聯絡方式(請不用填)：

臺大產學合作總中心

Tel: 02-3366-9945, E-mail: ntuciac@ntu.edu.tw